

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19)世界知的所有権機関  
国際事務局



(43)国際公開日  
2005年6月2日 (02.06.2005)

PCT

(10)国際公開番号  
WO 2005/050723 A1

(51)国際特許分類<sup>7</sup>: H01L 21/205, 21/31, C23C 16/511

[JP/JP]; 〒1078481 東京都港区赤坂五丁目3番6号  
Tokyo (JP).

(21)国際出願番号: PCT/JP2004/017162

(72)発明者; および

(22)国際出願日: 2004年11月18日 (18.11.2004)

(75)発明者/出願人(米国についてのみ): 石川拓  
(ISHIKAWA, Hiraku) [JP/JP]; 〒6600891 兵庫県尼崎市扶桑町1-8 東京エレクトロンAT株式会社内  
Hyogo (JP).

(25)国際出願の言語: 日本語

(74)代理人: 金本哲男, 外(KANEMOTO, Tetsuo et al.);  
〒1620065 東京都新宿区住吉町1-12 新宿曙橋ビル  
はづき国際特許事務所 Tokyo (JP).

(26)国際公開の言語: 日本語

(81)指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,  
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,  
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,

(30)優先権データ:  
特願2003-389469

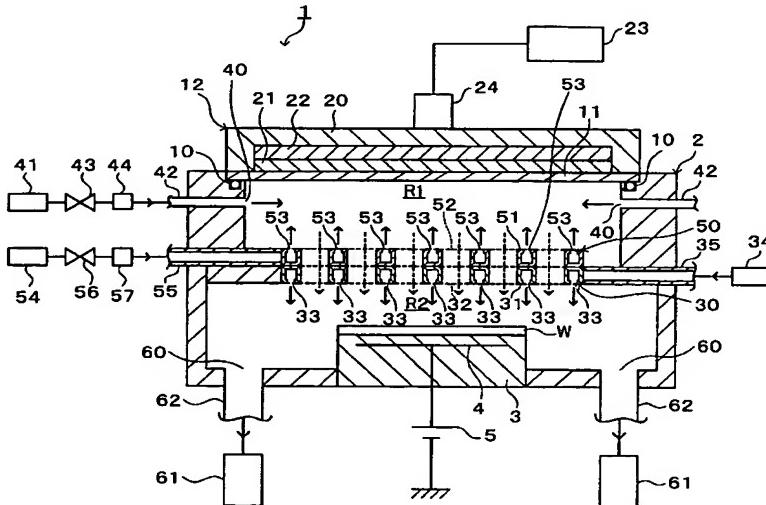
2003年11月19日 (19.11.2003) JP

[統葉有]

(71)出願人(米国を除く全ての指定国について): 東京エレクトロン株式会社 (TOKYO ELECTRON LIMITED)

(54) Title: PLASMA FILM-FORMING APPARATUS AND PLASMA FILM-FORMING METHOD

(54)発明の名称: プラズマ成膜装置及びプラズマ成膜方法





ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,

IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。